

微細加工 / 電子線描画装置

日本電子株式会社製

設置場所： バイオナノテクノロジーセンター（片柳研究所棟 地下1階分室1）



電子線ビームにより微細なパターンを描き、精密な微細加工が行える装置です。ナノレベルで複雑なパターンが描画できるため、極めて微細なパターンを作製することができます。半導体加工やデバイスの研究開発への応用が可能です。

装置の特長

- 汎用のCAD/CAMで複雑なパターンニングが可能
- 別のCADでパターンニングしたデータをDXF・DWGなどのファイル形式で取り込み可能

主な仕様

- 加速電圧 0.5 kV ~ 30 kV
- 描画方式 ラスター、ベクター、ショット描画
- 図形つなぎ精度 0.3 μ m以下
- 図形重ね精度 0.4 μ m以下
- 最小描画線幅 20 nm
- 電子銃 ZrO/W <100> ショットキー方式